PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-074664

(43) Date of publication of application: 26.03.1993

(51)Int.CI.

H01G 9/04 H01G 9/04

(21)Application number: 03-262923

(71)Applicant : ELNA CO LTD

(22)Date of filing:

13.09.1991 (72)Invent

(72)Inventor: ADACHI KAZUYUKI

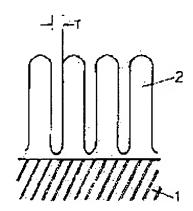
MOCHIZUKI MITSURU KAZUHARA MANABU

(54) ELECTROLYTIC CAPACITOR AND MANUFACTURE OF ELECTRODE FOIL FOR THE SAME CAPACITOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an excellent electrode foil having a small change in electrostatic capacity and to obtain an electrolytic capacitor having stable reliability for a long period by forming a titanium thin film or a titanium nitride thin film on an aluminum foil base material, surface—treating it with inorganic acid, and then heat—treating it at a predetermined temperature.

CONSTITUTION: A titanium thin film or a titanium nitride thin film is formed on an aluminum foil base material 1, the surface is treated with inorganic acid, and then heat-treated at a predetermined temperature. In this case, it is desirable to form a titanium thin film or a titanium nitride thin film in which an interval T of adjacent columns 2 is 50A or more on the material 1. An electrode foil can be used as an anode foil, but it is desirable to be used as a cathode foil. For example, a titanium deposited film is formed $0.1\mu m$ thick on a smooth aluminum base material 1 having a thickness of 22 μm . It is dipped in aqueous phosphoric acid solution of 10.9 wt.% at 40°C for 2 min, washed, and heat-treated at 420° C in the atmosphere for 1 min.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

BEST AVAILABLE CORY

Searching PAJ Page 2 of 2

- [Patent number]
- [Date of registration]
- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

HOIG 9/04

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出頗公開音号

特開平5-74664

(43)公開日 平成5年(1993)3月26日

(51)Int.CL5

識別記号

庁内監理番号

3 4 6 7924-5E 301. 7924-5E

技術表示貿所

審査請求 未請求 請求項の数4(全 4 頁)

(21)出頗吞号

特與平3-262923

(71)出原人 000103220

エルナー株式会社

(22)出戰日

平成3年(1991)9月13日

神奈川県藤沢市辻盆新町2丁目2番1号

(72)発明者 安達 和季

神奈川県藤沢市注堂新町2丁目2番1号

エルナー株式会社内

(72) 発明者 望月 充

神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号

エルナー株式会社内

(72) 発明者 数原 学

神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号

エルナー株式会社内

(54)【発明の名称】 電解コンデンサおよび電解コンデンサ用電優裕の製造方法

(57)【要約】

【目的】チタン蒸音笛の静電容置の低下を防止する。

【構成】チタン蒸着箔を無機酸にて表面処理し、しかる

後に熱処理を行なう。

(2)

特開平5-74664

【特許請求の範囲】

【語求項1】アルミニウム搭基材上にチタン薄漿および /または50化チタン薄膜を形成し、無機酸にて表面を処 **廻し、しかる後に所定の温度で熱処理を行なうことを特** 徴とした電解コンデンサ用電極笛の製造方法。

1

【請求項2】アルミニウム裕基材上に相隣なるカラムの 聞隔が50オングストローム以上のチタン薄膜および/ または窒化チタン薄膜を形成することを特徴とする請求 項1に記載の電解コンデンサ用電極着の製造方法。

したことを特徴とする請求項1または語求項2に記載の 電解コンデンサ用電極笛の製造方法。

【請求項4】陽極箔と陰極箔をセパレータを介在させて コンデンサ素子とし、同コンデンサ素子に駆動用電解液 を含浸した電解コンデンサにおいて、アルミニウム箔基 材上にチタン薄膜および/または窒化チタン薄膜を形成 し、無機酸にて表面を処理し、所定の温度で熱処理を行 なった電極箔をコンデンサ素子の陰極器として使用した ことを特徴とする電解コンデンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、基村表面に蒸着皮膜を 形成した電解コンデンサ用電極箔の製造方法および同電 極着を使用した電解コンデンサに関するものである。

【従来の技術】アルミニウムなどの弁作用金属の陽極額 と陰極箔をセパレータを介在させて参回してコンデンサ 素子とした電解コンデンサは、一般にコンデンサ素子に 駆動用電解液を含浸し、アルミニウムなどの金属製ケー スや合成樹脂製のケースにコンデンサ素子を収納し、弦 30 閉した枠造を有する。

【①①①3】とのような電解コンデンサの駆動用電解液 としては従来。エチレングリコールやァーブチロラクト ンなどの極性有機溶媒の単体あるいはその混合物を主溶 媒とし、これにカルボン酸またはその塩を恣質とし、ま た必要により経類、水分、リン酸などを添加剤として溶 解した電解液が一般に使用されている。

【①①①4】また、電解コンデンサの静電容量を高める ために、電極材料の基材であるアルミニウム笛の表面積 を化学的にあるいは電気化学的にエッチングにより拡大 40 することが行なわれているが、エッチングが過度になる とアルミニウム箔表面の溶解が同時に進行して却って拡 面率の増大を妨げることなどの理由から、エッチング技 衛による電極材料の静電容量の増大化には限界があっ た。このような問題点を解決するために、弁作用金属で あるアルミニウム箔を基材とし該基材表面を粗面化した 後に、この基材表面に蒸着法により蒸着皮膜を形成した 電極材料を陰極として使用することも特開昭61-18 0420号、特開昭61-214420号、特開昭62 - 58609号、特闘昭62-15813号、特開昭6 50 陽(陰間)が50オングストローム以上であると、駆動

4-33918号、特開昭63-100711号、特開 平1-304720号公頼などにより知られている。

【①005】予め基材表面に物理的。化学的または電気 化学的に微細な凹凸を形成すると、蒸着箱の静電容量を 増加させる効果が認められる場合があるが、このような 加工は基材の強度、伸度を著しく損ない、また凹凸加工 工程を必要とするのでコスト面で不利な選択を強いられ ていた。

【0006】また、蒸着方法について種々の提案が特関 【請求項3】基材に実質上平滑なアルミニウム箔を使用 10 昭56-29669号、特開昭64-33915号、特 関昭64-33918号公報などにより知られている。 即ち、蒸者角度を付けたり、基材を冷却しつつ蒸着する ことによりチタンを柱状に形成させ、静電容置の発現を 達成することが知られている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、蒸着後のチ タン皮膜は不安定であり、例えば大気中では箔の静電容 置の低下を招いたり、コンデンサ製品の静電容量の経時 変化が大きいという問題点があった。このような問題点 20 を解決するために蒸者皮膜を形成した後に、所定の温度 で熱処理を行なうことも特開平2-17623号公報に より知られているが未だ不充分であった。

1000081

【課題を解決するための手段】このような課題を解決す るために、本発明者らは種々の実験および検討を行なっ た結果、アルミニウム鉛基材上にチタン薄膜および/ま たは窒化チタン薄膜を蒸着して形成した後に、とれを無 機酸にて表面処理し、所定の温度で熱処理を行なうと、 静電容量の変化が少ない良好な電解コンデンサ用電極箔 を得ることができることを見い出した。無機酸はリン 酸、硝酸、塩酸、硫酸、ホウ酸またはそれらの混合水溶 液が例示される。無機酸による表面処理としては、無機 酸の水溶液中にチタン蒸着箔を浸漬して処理するのが好 ましい。また、熱処理は大気中または不活性ガスの雰囲 気中の常圧下または減圧下において、頒熱して処理する のが好ましい。加熱温度としては300~500℃の範 囲が好ましい。 加熱時間は30秒ないし10時間が好ま しい。加熱温度が高い場合は、酸素分圧を下げたり、時 間を短くして過度の反応を抑えるのが好ましい。実質的 に平滑なアルミニウム箔の基材にチタンを柱状に蒸着に より形成させる場合、即ち、図1にチタン蒸着箱皮膜機 造の模式図を示すが、アルミニウム墓材1上に形成され たチタンの柱状物(以下、カラムという) 2と他のカラ ム2の間隔下が密であると、相隣なるカラム2、2間に 上途した駆動用電解液が充分に含浸されずに静電容量の 発現性が低下してしまうという問題点がある。つまり、 相隣なるカラムの間隔 (間隙) が5()オングストローム 未満であると、駆動用電解液の含浸性が悪く、静電容置 の発現性が乏しい。しかしながら、組隣なるカラムの間

用電解液の含浸性が改善され、静電容量の発現性が良好 になる。 特には、50~5000オングストロームの範 囲が非常に良好である。

【0009】本発明において、基材としてはアルミニウ ム岩が好適に使用され、上述のような微細な凹凸が形成 されたアルミニウム箔基村であっても、また実質上平滑 なアルミニウム浴基材であってもよい。平滑なアルミニ ウム箔を基材に用いることは、引張強度や値度を損わず に基材の厚さを薄くすることが可能であり、またコスト 的にも租面化する工程が不要なために有利である。この 10 る。 ような基材はコンデンサ素子の陽極着としても使用でき るが、陰極箔として使用するのがむしろ好ましい。

【①①10】一方、本発明に用いられるコンデンサ素子 の陰極箔としては、5~60μmの厚さの実質上平滑な アルミニウム箔が基材として使用されるが、特に10~ 40 μmのものが好適に使用される。アルミニウム基材 へのチタンの付着形成法としては真空蒸着法、スパッタ リング法、イオンプレーティング法、CVD法などを例 示することができる。また、真空中または酸素ガス、窒 素やアルゴンなどの不活性ガスなどの雰囲気中で50~ 3000オングストロームの厚さに付着形成するのが好 ましい。特に窒素ガス中で蒸着条件を選ぶと窒化チタン 蒸着膜を形成させることができる。該室化チタン蒸着膜 にはT:Nx(i)<x≤4/3)で表わされる部分的に 窒化されたチタン薄膜も含まれる。また、該窒化チタン 蒸着機には窒化チタンと酸化チタンの混合膜も含まれ

【①①11】本発明において使用される駆動用電解液の 有機極性溶媒としては、電解コンデンサに通常使用され る有機極性溶媒であればいずれも使用できる。

【0012】好ましい溶媒としては、アミド類、ラクト ン類。グリコール類、硫黄化合物類。ケトン類。エーテ ル類または炭酸塩類が使用できる。好ましい具体例とし ては、炭酸プロピレン、N、N - ジメチルホルムアミ ド、N-メチルホルムアミド、γープチロラクトン、N - メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、エチレン シアノヒドリン。エチレングリコール。エチレングリコ -ルモノまたはジアルキルエーテル、3-アルキルー 1、3-オキサゾリジン-2-オンなどが使用できる。 特に好ましくは、ラクトン類、エチレングリコール類な 40 は-16%であった。 どが用いられる。

【①①13】本発明において使用される駆動用電解液の **窓智としては、電解コンデンサに通常使用される溶質で** あればいずれも使用できる。

【0014】好ましい恣囂としては、ホウ酸やリン酸な どの無機酸またはその塩、ケイタングステン酸などのへ テロポリ酸またはその塩、フェノール性水酸基を有する 有機酸またはその塩、スルホン酸基を有する有機酸また はその塩、ギ酸やドデシル酸に代表される鎖式モノカル る芳香族モノカルボン酸またはその塩. アジピン酸やセ バシン酸に代表されるる鎖式ジカルボン酸またはその 塩、マレイン酸やシトラコン酸などの不飽和ジカルボン 酸またはその塩、フタル酸やニトロフタル酸やテトラヒ ドロフタル酸からなる環式ジカルボン酸またはその塩、 クエン酸に代表されるトリカルボン酸またはその塩を例 示することができる。特に好ましくは、芳香族カルボン 酸または不飽和ジカルボン酸の4級アルキルアンモニウ ム塩、芳香族カルボン酸のアンモニウム塩が採用され

【0015】また、塩としてはアンモニウム塩、第1~ 第3級アミン塩、第4級アンモニウム塩を例示すること ができる。また、伝導度を高めるために水分を添加する が、コンデンサ特性の経時変化を抑止するためには15 %以下、好ましくは8%以下、特に好ましくは5%以下 が採用される。

[0016]

【実能例】

【0017】<実施例1>厚さ22µmの平滑なアルミ 20 ニウム基材にチタン蒸着皮膜を 0.1μmの厚さに形成 した。これを40℃、10.9w1%のリン酸水溶液に 2分間浸漬を行ない、水洗し、420℃の大気中雰囲気 中で1分間熱処理した。との基材の静電容量を測定した ところ9 θ μ F / c m * であった。さらに、この基材 を、水分1wt%、γープチロラクトン74wt%、ο -フタル酸テトラエチルアンモニウム25wt%からな る。110 ℃の電解液中に浸漬し、240 h r 放置後の 静電容量を測定したところ? 7 μ F / c m² で、容量変 化率は-14%であった。

【0018】<実施例2>厚さ22µmの平滑なアルミ ニウム基材にチタン蒸着皮膜を0.1μmの厚さに形成 した。これを40℃、10.9×1%のリン酸水溶液に 2分間浸漬を行ない、水洗し、380℃の窒素雰囲気中 で2分間熱処理した。この基材の静電容量を測定したと ころ95 u F / c m' であった。さらに、この墓材を、 水分1wt%. ァーブチロラクトン?4wt%. ローフ タル酸テトラエチルアンモニウム25wt%からなる、 110℃の電解波中に浸漬し、240hm放置後の静電 容量を測定したところ80 μF/cm¹ で、容量変化率

【0019】 <実施例3>厚さ22μmの平滑なアルミ ニウム基材にチタン蒸着皮膜を0.1μmの厚さに形成 した。これを40℃、8.8wt%の硝酸水溶液に2分 間浸渍を行ない。水洗し、420℃の空気雰囲気中で1 分間熱処理した。この基材の静電容量を測定したところ 80μF/cm:であった。さらに、この基材を、水分 lwt%、γープチロラクトン74wt%、οーフタル 酸テトラエチルアンモニウム25wも%からなる。11 0°Cの電解液中に浸漬し、240hr放置後の静電容置 ボン散またはその塩、安息香酸やサリチル酸に代表され 50 を測定したところ72μFノcm⁴で、容量変化率は-

(4)

特開平5-74664

10%であった。

【0020】<実施例4>厚さ22µmの平滑なアルミ ニウム箔に相隣なるカラムの間隔が100オングストロ - ムであるチタン蒸者皮膜を0. 1 μ mの厚さに形成し た。これを40℃、10.9wt%のリン酸水溶液に2 分間浸漬し、水洗した後に380℃の窒素気流中で2時 間熱処理して除極管とした。隔極酸化皮膜の形成された 9 O μmのアルミニウム陽極箱と、該除極箱をセパレー タを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコン w t%、o-フタル酸テトラエチルアンモニウム25w 1%からなる駆動用電解液を含浸させ、外装ケースに組 み込んで定格25V3300μFの電解コンデンサを製 作した。このコンデンサの静電容量は3310μFであ った。

5

【0021】 <比較例1>厚さ22μmの平滑なアルミ ニウム基材にチタン蒸着皮膜を0.1μmの厚さに形成 した。これを420℃の大気中雰囲気中で1分間熱処理 した。この基材の静電容量を測定したところ73 μF/ cm² であった。さらに、この基材を、水分1wt%、 γ-プチロラクトン74wt%、0-フタル酸テトラエ チルアンモニウム25 w t %からなる。110°Cの電解 液中に浸漬し、240hr放置後の静電容置を測定した ところ62 μF/cm'で、容置変化率は-15%であ

【0021】<比較例2>厚さ22μmの平滑なアルミ ニウム基材にチタン蒸着皮膜を0.1μmの厚さに形成 した。この基材の静電容量を測定したところ86 μF/ cmi であった。さらに、この基材を、水分lwt%、 γープチロラクトン7.4 w t%、0ーフタル酸テトラエ 30 チルアンモニウム25 w t %からなる。110 ℃の電解*

*液中に浸漬し、240 hr放置後の静電容量を測定した ところ61µF/cm4で、容置変化率は-29%であ

【0022】 <比較例3>厚さ22μmの平滑なアルミ ニウム基材にチタン蒸着皮膜を0.1μmの厚さに形成 した。これを40℃、8.8wt%の硝酸水溶液に2分 間浸渍を行ない。水洗して静電容量を測定したところ1 ①8μF/cm²であった。さらに、この基材を、水分 lwt%、γープチロラクトン74wt%、οーフタル デンサ菓子に、水分1wt%、ァープチロラクトン74 10 酸テトラエチルアンモニウム25wt%からなる.11 0℃の電解液中に浸漬し、240hr放置後の静電容量 を測定したところ63 u F / c m * で、容置変化率は-42%であった。

[0023]

【発明の効果】比較例2のように蒸着したままのチタン 蒸着箔はその静電容置変化率が-29%と非常に大き い。また、比較例1のように熱処理のみでは初期静電容 置は73 u F / c m² と低い。比較例3のように酸によ る表面処理のみでは静電容量変化率が-42%となり、 20 比較例2より悪くなってしまう。これに対して、無機酸 にて表面処理し、かつその後に熱処理した、本発明に係 るチタン蒸者浴はその静電容量変化率を-10%台に抑 えることができ、かつ初期容置を発現できる。よって、 本発明に係るチタン蒸者箔を使用した電解コンデンサは 長期間にわたって安定な信頼性を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】チタン蒸着箔皮膜構造の模式図。

【符合の説明】

- 1 アルミニウム基材
- 2 カラム

[図1]

